



03500.016072.1

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)
MINEO SHIMOTSUSA, ET AL.) Examiner: Unassigned
Application No.: 10/657,269) Group Art Unit: 2811
Filed: September 9, 2003)
For: SEMICONDUCTOR DEVICE,) March 8, 2004
METHOD FOR MANUFACTURING)
THE SAME, AND LIQUID JET)
APPARATUS)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

LETTER

Sir:

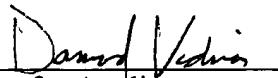
Applicants respectfully direct the Examiner's attention to the enclosed Korean Office Action which issued during prosecution of a Korean patent application corresponding to the above U.S. application.

The Korean Office Action, which is dated January 28, 2004, cites Japan 62-98764 and Japan 8-97410. Since these documents were already cited in the Information Disclosure Statement dated September 8, 2003, a Form PTO-1449 does not accompany this Letter.

No fee is believed due; however, any fee required in connection with this paper should be charged to Deposit Account No. 06-1205. A duplicate of this paper is enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,



Attorney for Applicants
Damond E. Vadnais
Registration No. 52,310

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200
DEV/lIp

DC_MAIN 159348v1

FO160724R

「翻訳文」

発送日付 : 2004. 01. 28.

提出期日 : 2004. 03. 28.

特許庁 意見提出通知書

出願人 キヤノン株式会社

代理人 慎重勲 外1名
大韓民国 SEOUL特別市 瑞草区 瑞草4洞 1678-2 東亞Villart 2 Town 302号

出願番号 10-2001-0086492

発明の名称 SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD FOR MANUFACTURING THE
SAME, AND LIQUID JET APPARATUS

この出願に対する審査の結果、下記のような拒絶理由があるので、特許法第63条の規定によりこれを通知しますから、意見があるとか補正を要する場合には、上記提出期日までに意見書[特許法施行規則別紙第25号の2書式]又は／及び補正書[特許法施行規則別紙第5号書式]を提出されたい(上記提出期日に対して、毎回1月単位で 延長を申請することができ、この申請に対し別途の期間延長承認の通知は行いません)。

【理由】

この出願の特許請求の範囲の請求項1～28に記載された発明は、その出願前にこの発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が下記に指摘したものに基づいて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

【記】

本願の請求の範囲の請求項1～17は半導体装置およびその製造方法に関するもので、半導体基体の一主面に設けられた第2導電型の第1の半導体領域と、第1の半導体領域に近接して設けられ、チャンネル領域を形成する第1導電型の第2の半導体領域と、前記第2の半導体領域の表面側に設けられた第2導電型のソース領域と、前記第1の半導体領域の表面側に設けられた第2導電型のドレイン領域と、ゲート絶縁膜がゲート電極の間に置かれた状態においてチャンネル領域上に設けられたゲート電極とをそれぞれ含み；また第2の半導体領域は、横方向にドレイン領域を分離するように並んで

配列された2つのドレン領域の間に配置され、第1の半導体領域の不純物濃度より高い不純物濃度を有すること等を特徴とするが、これは、引用発明1(日本特開昭62-98764号)に開示された、CMOS型半導体装置の形成方法と、引用発明2(日本特開平8-97410号)に開示された、自己整合した横型DMOSトランジスタの製造法に基づいて通常の知識を有する者が容易に発明をすることができる。

[添付]

添付1 日本公開特許公報昭62-098764号(1987.05.08.) 1部

添付2 日本公開特許公報平08-097410号(1996.04.12.) 1部

2004.01.28.

特許庁

출력 일자: 2004/1/29

136

발송번호 : 9-5-2004-002705891
발송일자 : 2004.01.28
제출기일 : 2004.03.28

수신 : 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2
타운 302호
신중훈 귀하

137-882

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 캐논 가부시끼가이사 (출원인코드: 519980959073)
주소 일본 도쿄도 오오따꾸 시모마루꼬 3조메 30방 2고
대리인 성명 신중훈 외 1명
주소 서울 서초구 서초4동 1678-2 동아빌라트2타운 302호
출원번호 10-2001-0086492
발명의 명칭 반도체장치와, 그 제조방법 및 액체분사장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지합니다. 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출 기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인을 받는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-28항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

본원의 청구범위 제1-17항은 반도체 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 반도체기판의 한쪽 주면위에 형성된 제2도전형 제1반도체영역과, 제1반도체영역에 근접하여 형성되고 채널영역을 형성하는 제1도전형 제2반도체영역과, 상기 제2반도체영역의 표면측위에 형성된 제2도전형 소스영역과, 상기 제1반도체영역의 표면측위에 형성된 제2도전형 드레인영역과, 게이트절연막이 게이트전극과 이에 놓인 상태에서 채널영역위에 형성된 게이트전극과를 각각 포함하고; 또한 제2반도체영역은, 횡방향으로 드레인영역을 분리하도록 나란히 배열된 2개의 드레인영역사이에 배치되고 제1반도체영역의 불순율농도보다 높은 불순율농도를 가진 것 등을 특징으로 하나, 이는 인용발명1(일본특개소 62-98764호)에 개시된, CMOS형 반도체 장치의 형성방법과, 인용발명2(일본특개평8-97410호)에 개시된, 자기정합 횡형 DMOS트랜지스터의 제조방법으로부터 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

[첨부]

첨부 1 일본공개특허공보 소62-098764호(1987.05.08) 1부
첨부2 일본공개특허공보 평08-097410호(1996.04.12) 1부 끝.

2004.01.28

특허청

심사4국

반도체2심사담당관실

심사관 임동우



출력 일자: 2004/1/29

<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5750 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터